# 大口径铜蒸气激光器的动力学分析

于德利 王润文 陶永祥

(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800) (1999年3月30日收到;1999年4月24日收到修改稿)

通过建立调整大口径铜蒸气激光器的动力学模拟过程中的有关动力学参数,得到一适用于不同输出功率的大口径铜蒸气激光器动力学模型.在此基础上对大口径铜蒸气激光器的径向动力学参量进行了计算,包括激励电场和亚稳态铜粒子密度等动力学参量的径向分布.给出了大口径铜蒸气激光器的径向电子温度及发光强度分布.尔后得到在不同充电电压及缓冲气压条件下铜蒸气激光器的输出功率,此程序对 $\Phi = 6.5 \text{ cm}$ 的大口径铜蒸气激光器的计算结果与实验符合得相当好.

PACC: 4255

# 1 引 言

作为激光同位素分离抽运源和拥有其他广泛应 用前景(例如材料加工)激光治疗等)的大口径铜蒸 气激光器 1] 人们希望其单位体积的输出功率和激 光效率越高越好,目前我国单台铜蒸气激光器最大 输出功率百瓦左右,与世界上先进国家近千瓦的输 出功率相比还有一定差距[2,3],铜蒸气激光器由小 口径向大口径大功率发展过程中遇到了一系列技术 上的困难 譬如激光管与电源的匹配问题 激光器件 的结构问题 激光脉冲 黑心 "问题以及激光管内详 细动力学过程等等[3-9]开展小口径及大口径铜蒸 气激光器动力学方面的研究是十分必要的,迄今铜 蒸气激光器模型的动力学参数并不完整 建立通用 性很好的铜蒸气激光器动力学模型,以至将来发展 成铜蒸气激光器计算机辅助设计(CAD),其意义是 重大的,在这方面已有小口径铜蒸气激光器的自洽 动力学模型及大口径铜蒸气激光器动力学模 型<sup>8-11]</sup>.我们在小口径铜蒸气激光器物理模拟程序 的基础上发展了大口径铜蒸气激光器的自洽物理模 拟程序,在与实验对比的基础上确定了一些动力学 参数.对比不同缓冲气压和充电电压条件下的激光 输出功率及激光脉冲空间分布、计算结果与实验结 果的趋势符合得很好,因此可以利用此程序预测新 的实验条件下的实验结果,还可以发展成独立的大 口径铜蒸气激光器的计算机辅助设计程序,优化激 光器物理参数和结构参数.

本文首先给出大口径铜蒸气激光器的动力学方 程,包括放电电路,激光管内电场偏微分方程,电子 温度偏微分方程,各能级铜粒子及铜离子偏微分方 程,光强微分方程和放电管内气体温度偏微分方程. 用数值计算方法获得以上方程组的自洽解,结合实 验对比讨论了激光过程中的一些动力学特性,阐明 了大口径铜蒸气激光器内部的物理机制,并解释了 一些新的物理现象.最后给出不同缓冲气压和充电 电压条件下大口径铜蒸气激光器的输出功率及激光 脉冲空间分布等实验结果.

## 2 电路及动力学方程

(1)电路方程

采用与文献 9 相同的放电电路和方程组

- $dI_1/dt = (V_1 V_2 I_1R_{th})/L_1$ , (a)
- $dI_2/dt = (V_2 V_d)/L_2$ , (b)
- $dV_1/dt = -I_1/C_s$ , (c)
- $dV_2/dt = (I_1 I_2)/C_p.$  (d)

(2)动力学方程

激光管内的电场是激光管内部动力学参量变化 的直接原因,也是激光管内部参量与外部放电电路 参量最为密切的参量,我们采用的电场方程为

$$\frac{\partial E(r_{t},t)}{\partial t} = \frac{1}{\mu_{0}\sigma(r_{t},t)r} \frac{\partial E(r_{t},t)}{\partial r} + \frac{1}{\mu_{0}\sigma(r_{t},t)} \frac{\partial^{2}(E(r_{t},t))}{\partial r^{2}}, \quad (1)$$

其中 E(r,t)为与时间 t 激光管内径向 r 点有关的

电场. $\mu_0$ 为真空磁导率. $\sigma(r,t)$ 是与时空有关的等离子体电导率.

电子温度  $T_e$ 是大口径铜蒸气激光器内最为灵 敏的动力学参量 其表达式为

$$\frac{\partial T_{\ell}(r,t)}{\partial t} = TE(r,t) + \frac{2\lambda_{e}}{3kn_{\ell}(r,t)} \frac{\partial^{2}T_{\ell}(r,t)}{\partial r^{2}} + \left[T_{\ell}(r,t)\left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{u}{r}\right) + u\frac{\partial T_{\ell}(r,t)}{\partial r} + u\frac{T_{\ell}(r,t)}{n_{e}}\frac{\partial n_{\ell}(r,t)}{\partial r}\right] + \frac{2}{3kn_{\ell}(r,t)}\left[\left(\frac{\lambda_{e}}{r} + \frac{\partial \lambda_{e}}{\partial r}\right)\frac{\partial T_{\ell}(r,t)}{\partial r} - \frac{3}{2}\frac{T_{\ell}(r,t)k\partial n_{\ell}(r,t)}{\partial t}\right], \quad (2)$$

其中

$$TE(r_{i}t) = \frac{2}{3} \left( \frac{e^{2}E^{2}(r_{i}t)}{m_{e}} + \frac{1}{n_{e}(r_{i}t)} \right)$$
$$\cdot \sum_{\substack{j \neq l \\ j \neq l}} k_{jl} N_{j} N_{l} \Delta \varepsilon_{jl} + \sum_{j}^{8} r_{j}^{e} N_{j} \Delta \varepsilon_{j}^{e} \right)$$

 $-2(T_{c}(r_{t}) - T_{c}(r_{t}))k_{m}.$  (3)

(3)式中第一项表示外加电场的激励能贡献.第 二项表示介质粒子(包括铜和氖)间的碰撞交换能变 化 其中  $\Delta \epsilon_{jl}$ 表示  $N_i \leq N_j$ 粒子的碰撞反应能量,  $m_e e \ \pi n_e \ \Delta \pi n_e \ \Delta \eta_b$ 电子的质量、电量和密度, $k_{jl} \ \Delta n_j$ 能级粒子与 $N_l$ 能级粒子碰撞,被激励到  $N_i$ 能级 的超弹性碰撞系数.第三项表示电子与粒子的碰撞 能量交换, $r_j^e$ 的电子与 $N_j$ 粒子的激发或去激发碰 撞系数  $\Delta \epsilon_j^e$ 为碰撞交换能.第四项表示电子与粒子 弹性碰撞过程能量交换,其中  $k_m$ 表示弹性碰撞给 铜原子及氖原子能量的概率系数, $T_g(r,t)$ 表示管 内缓冲气体温度<sup>[9]</sup>.(2)式中的第二项是电子径向 运动,以后的各项是热传导项.式中  $\lambda_e$  为电子热传 导系数,u 为电子径向运动速度,k 为玻尔兹曼常 数.

激光管内电子密度方程为

$$\frac{\partial n_{\ell}(r,t)}{\partial t} = NE(r,t) - \left(\frac{un_{\ell}(r,t)}{r} + u\frac{\partial n_{\ell}(r,t)}{\partial r} + n_{\ell}(r,t)\frac{\partial u}{\partial r}\right)(4)$$

其中

$$NE(r_{i}t) = \sum_{j} (r_{j5}N_{j} - \overline{r}_{5j}N_{5})n_{e}(r_{i}t) - n_{e}(r_{i}t) \sum_{j=5.8} n_{e}(r_{i}t) + K_{j}N_{j} + K_{p}N_{2}N_{7}, \quad (5)$$

(5)式中第一项表示电子与粒子碰撞引起的电离及 消电离,第二项表示离子与双电子碰撞复合,使其跃 迁至电离能级以下能级态粒子,*K<sub>j</sub>*为系数.第三项 表示彭宁碰撞引起铜原子电离对电子密度的贡献, *K<sub>p</sub>*为彭宁碰撞系数<sup>[9]</sup>.(4)式中第二项是电子径向 运动项.

激光管内各能级粒子数密度方程为

$$\frac{\partial N_i}{\partial t} = \sum_{\substack{j \neq l \\ j \neq 2,3}}^{8} (r_{ji}N_j - \overline{r}_{ij}N_i) n_{\ell} (r_{l}t)$$

$$+ \sum_{\substack{j,l \\ j \neq l, \\ j \neq 2,3}} k_{jl}^i N_j N_l + \sum_{\substack{j=5 \text{ or } 8}} k_{jl} N_j n_{\ell}^2 (r_{l}t) N_l$$

+ $\nabla \cdot (D_i \cdot \nabla N_i) - \nabla \cdot (N_i u_s).$  (6) (6)式代表  $N_i$  能级粒子数的变化速率 ,第一项表示 电子激励的贡献 ,其中  $r_{ji}$ 代表电子碰撞介质粒子 $N_j$ 能级激励因子 ,相反  $\overline{r}_{ij}$ 为电子对 $N_i$  能级的消激励 因子 . 第二项含义是介质中粒子相互碰撞对  $N_i$  能 级的粒子的贡献 ,其中  $k_{jl}^i$ 为 $N_j$  能级粒子与 $N_l$  能级 粒子间碰撞 ,激励到  $N_i$  能级的粒子的激励因子 . 第 三项表示由于双电子碰撞引起的铜和氖的电离能级 粒子消激励 ,到达  $N_i$  能级的粒子数 , $k_{ji}$ 为激励因 子<sup>[9]</sup>. 第四项为此粒子热扩散项 , $D_i$  为热扩散系数 . 第五项铜蒸气介质团簇运动过程变化量 , $u_s$ 为输运 系数 .

激光光强方程为

$$\frac{\partial I(r,t)}{\partial t} = BI(r,t) \Delta NL_T / L_0 - cI(r,t)$$

·((1 –  $R Y L_0 + \gamma )K + hxcaN_3 A$ ,(7) 式中 A 为激光上能级粒子  $N_3$  自发辐射系数 ,B 为 激光上能级受激辐射系数 ,I 为激光光强 , $\Delta N$  为激 光反转粒子数 , $L_T$  为放电管长度 , $L_0$  为光腔长度 ,c为光速 ,R 为腔镜反射率 , $\gamma$  为分布损耗 , $h\nu$  为光子 能量 ; $\alpha$  为几何因子 , $\alpha = \pi R_T^2 / (4\pi L_T^2) K$  为激光器 件参量的函数<sup>[9]</sup>.

放电管内缓冲气体温度的径向分布方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{3}{2} N_e k T_g(r t) \right) = J E(r t)$$

$$+ \sum_j \frac{3}{2} n_g(r t) k \frac{2m_e}{M_j} (T_g(r t) - T_g(r t))_m$$

$$+ \left( \frac{\lambda_g}{r} \frac{\partial T_g(r t)}{\partial r} + \frac{\partial \lambda_g}{\partial r} \frac{\partial T_g(r t)}{\partial r} + \lambda_g \frac{\partial^2 T_g(r t)}{\partial r^2} \right).$$

$$(8)$$

(8)式中  $N_{e}$ 为缓冲气体氛粒子数密度 J 为电流密度  $M_{i}$ 为氛原子质量  $\mu_{m}$ 为弹性碰撞频率  $\lambda_{g}$ 为缓

冲气体氛的热传导系数[18].

对于由放电电路常系数微分方程组和(1)(2), (4)(6)(8)式非线性偏微分方程组成的方程组,我 们分别采用 ronge-kutta 及差分方法求解.通过迭代 计算达到自洽,迭代误差小于 5%.方程中各项计算 采用的初始值,气体温度采用静态动力学参量下的 缓冲气体温度分布,电子密度径向分布为近似贝塞 尔函数分布等.

3 计算结果及动力学分析

在计算程序中大部分动力学参量取自于文献 [1,9—11],也有个别参量,例如铜原子碰撞电离截 面,弹性碰撞截面和亚稳态铜原子的热扩散系数等, 做了相对调整使得与我们的实验实际相符.通过计 算可以得到大口径铜蒸气激光器运行过程中的一些 动力学参量的变化过程.首先得到激光管放电电流,





如图 1,此计算值与实验值是相符的<sup>7,91</sup>.我们在调整放电电路与铜蒸气激光器管内动力学参量的关系时发现,铜蒸气激光器的动力学参量(例如最高电子温度,电子密度)与放电回路的关系十分密切.这与我们实验中遇到的大口径铜蒸气激光器放电回路难调整是一致的.尤其是闸流管回路对放电管回路的反压尤为灵敏.

图 2 为放电管内电场的径向及时间分布函数. 由于我们讨论的是大口径铜蒸气激光器,所以必须 考虑电场的趋肤效应.

由图 2 可以看到,电场由管壁处的最大值逐渐 向管中心的最小值变化,放电管径向各点处的电场 极大值的出现在时间上有一滞后.

图 3 为亚稳态铜粒子密度变化曲线. 在铜蒸气

激光器运行过程中亚稳态铜粒子的去激发直接影响 到铜蒸气激光器的发光<sup>[11]</sup>.







图 3 亚稳态铜粒子时空变化

由图 3 可以看到在放电脉冲到来之前亚稳态铜 粒子在管中心的密度比管壁附近的密度高,这是因 为在上一个放电脉冲结束后管壁附近的亚稳态铜粒 子容易被管壁碰撞去激发,而管中心的亚稳态铜粒 子主要靠三体碰撞及彭宁碰撞去激发.当放电脉冲 到来之后管壁附近的亚稳态铜粒子密度上升幅度较 管壁附近的亚稳态铜粒子密度大,因为放电管壁附 近的电场强度较管中心处的电场强度大.

图 4 为放电管内电子温度空间径向时间分布 图.电子温度对于基态铜粒子向激光的上下能级跃 迁概率起决定作用.

由图 4 可以看到电子温度的径向分布并非一



图 4 电子温度时空变化

致,管中心的电子温度因放电电场及缓冲气体压的 不同而比管壁附近的电子温度或高或低.管中心的 电子温度开始升高的时间比管壁附近的电子温度升 高有一时间上的滞后,其下降的速度也较管壁附近 的电子温度缓慢.电子温度的上升及下降与放电电 场密切相关.

图 5 为铜蒸气激光器单个激光脉冲强度时空分 布曲线。





由图 5 可以看到管中心光脉冲产生较管壁处产 生光脉冲推迟几十 ns,这与实验上观察到的结果是 一样的<sup>[12]</sup>.我们由图 5 也可以看到此光脉冲与实验 一样也存在"黑心"现象<sup>[7]</sup>,表现在管壁处较管中心 处的光脉冲强度及宽度均要大.

### 4 物理参数设计

利用此大口径铜蒸气激光器动力学模拟程序可 以对 Φ=6.5 cm 的大口径铜蒸气激光器在不同的 缓冲气体压力下的激光输出功率进行计算.图6给 出了计算值和实验值比较.



#### 图 6 激光输出功率随气压变化

由图 6 可以看到理论计算与实验值的变化趋势 相同.峰值的错位和数值的差别可能一方面是由于 器件的闸流管能量耦合进激光管受限制所致,另一 方面可能是由于受到缺少高功率的实验数据,使得 计算参数的匹配不是最优造成,这方面需更进一步 的研究.在我们的 Φ=6.5 cm 的大口径铜蒸气激光 器充电电压为 20 kV(其他激光器物理参量图 1 中 所示 )时,由于闸流管能承受的最大耦合功率小于 10<sup>4</sup> W,高于 100 W 的激光输出功率无法比较.在我 们调试程序时可以看到当缓冲气压低时黑心现象严 重,当缓冲气压升高时"黑心"降低甚至消失,但激光 输出效率降低,这与我们实验观察到的现象一致.



图 7

由图 7 可以看到随着充电电压的增大输出功率 也增加,这与实验结果是相符的.在我们实验中由于 受到闸流管性能的限制,高于 20 kV 的条件无法进 行比较.我们的理论计算曲线表明当电压再加高,激 光输出功率上升很快.

### 5 结 论

由上面的分析可以得到以下结论:本文大口径 铜蒸气激光器动力学分析所采用的方程较全面地模 拟了器件内部的动力学过程,结果与实验有较好的 吻合.成功地解释了实验观察到的大口径铜蒸气激 光束产生的"黑心"现象.计算表明,它是由于在激光 管内断面电场分布不均匀引起的.模拟计算预期提 高充电电压(在储能电容值和重复频率不变的情况 下就是提高输入功率密度),能较大幅度提高激光输 出功率.这与实验结果趋势完全符合.

[1] Robert J. Carman , D. J. W. Brown , J. A. Piper , *IEEE*. J. Quant. Electron **30**(1994), 1876.

- [2] 陶永祥、尹宪华、陈林等,激光与光电子学进展,7(1996),189 [Tao Yongxiang,Yin Xianhua Chen Lin et al., Laser & Optronics Progress 7(1996),189(in Chinese)].
- [3] Nobutada Aoki, Hironobu Kimura, Chikara Konagai et al., SPIE ,1412 (1991) 2.
- [4] 陶永祥、尹宪华、陈林等,中国激光,A24(2)(1997),105[Tao Yongxiang,Yin Xianhua,Chen Lin *et al.*,*Chinese Journal of Lasers*,A24(2)(1997),105(in Chinese)].
- [5] 陶永祥、尹宪华、陈林等,光学学报,10(1998),1422[Chen Lin,Tao Yongxiang,Yin Xianhua *et al.*,*Acta Optica Sinica*, 10(1998),1422(in Chinese)].
- [6] Deli Yu, Yongxiang Tao, Xianhua Yin et al., Microwave and optical technology letters, 17(6) 1998) A02.
- [7] 梁宝根、陶永祥、尹宪华等,中国激光(激光器件专集) (1990),38[Liang Baogeng, Tao Yongxiang, Yin Xianhua et al., Chinese Journal of Lasers, Device Vlume (1990),38(in chinese)].
- [8] 程成、孙威、物理学报 46(1997) 897[Cheng Cheng Sun Wei, Acta Physica Sinica 46(1997) 897[in Chinese]].
- [9] Deli Yu, Yongxiang Tao, Xianhua Yin et al., Journal of Chinese Laser(中国激光海外版), B8(1)(1999), 21.
- [10] R.J. Carman J. Appl. Phys. 82 (1997),71.
- [11] M. J. Kushner , B. E. Warner J. Appl. Phys. 54 (1983) 2970.
- [12] 尹宪华、陶永祥、陈林等,中国激光,A24(4)(1997),293[Yin Xianhua,Tao Yongxiang,Chen Lin *et al.*,*Chinese Journal of Lasers*, A24(4)(1997),293(in Chinese)].

## KINETIC ANALYSIS OF LARGE-BORE COPPER-VAPOR LASER

YU DE-LI WANG RUN-WEN TAO YONG-XIANG

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics , Chinese Academy of Sciences , Shanghai 201800)
 (Received 30 March 1999; revised manuscript received 24 April 1999)

#### ABSTRACT

Through establishing and adjusting the kinetic parameters, a kinetic model for a series of large-bore copper-vapor lasers is completed. On the basis of this model the radius kinetic parameters are calculated, including the stimulating electric field and the metastable state copper density. The radial electron temperature and intensity of large-bore copper laser are presented. Then the output power under different buffer gas pressurs and charging voltages are given. These are in good agreement with the calculated and measured results for  $\Phi = 6.5$  cm copper vapor laser.

PACC: 4255